(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/206130 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/24 (2012.01) *C08G 18/48* (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/012375

(22) 国際出願日： 2025年3月27日(27.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

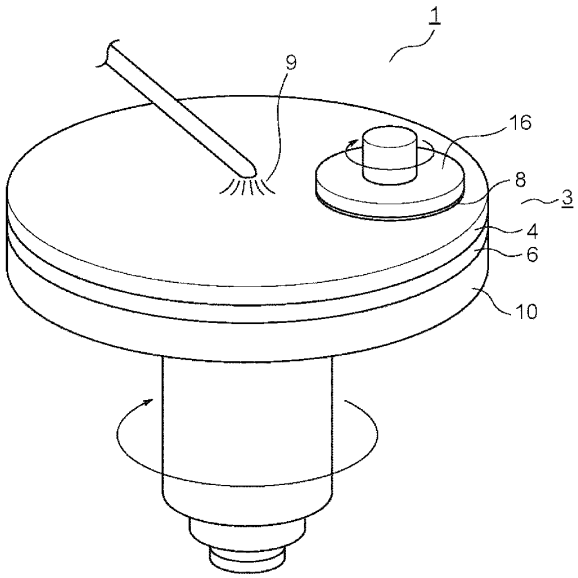
(30) 優先権データ：
特願 2024-050923 2024年3月27日(27.03.2024) JP
特願 2024-050924 2024年3月27日(27.03.2024) JP

(71) 出願人: 富士紡ホールディングス株式会社 (FUJIBO HOLDINGS, INC.) [JP/JP]; 〒1030013 東京都中央区日本橋人形町１丁目１８番１２号 (JP).

(72) 発明者: 栗原 浩 (KURIHARA Hiroshi); 〒7991342 愛媛県西条市大新田２７２ フジボウ愛媛株式会社内 (JP). ▲高▼見沢 大和 (TAKAMIZAWA Yamato); 〒7991342 愛媛県西条市大新田２７２ フジボウ愛媛株式会社内 (JP). 越智 恵介(OCHI Keisuke); 〒7991342 愛媛県西条市大新田２７２ フジボウ愛媛株式会社内 (JP). 川崎 哲明(KAWASAKI Tetsuaki); 〒7991342 愛媛県西条市大新田２７２ フジボウ愛媛株式会社内 (JP).

(54) **Title:** POLISHING PAD

(54) 発明の名称： 研磨パッド



(57) **Abstract:** The purpose of the present invention is to provide a polishing pad that excels in level difference elimination performance and flattening performance. The polishing pad has a polishing layer comprising a polyurethane resin foam for which an isocyanate-terminated prepolymer and a curing agent are raw materials, and the polishing pad is characterized in that: the ratio of the content proportion of a crystalline phase and the content proportion of an amorphous phase in the polishing layer measured via a pulse NMR method in a wet state at 40°C is 0.5-1.0; and the ratio of the content proportion

WO 2025/206130 A1

［続葉有］

(74) 代理人: 上 村　陽 一 郎 (KAMIMURA Yoichiro); 〒1030014 東京都中央区日本橋蛎殻町 １ － １ ３ － ７ 日本橋人形町プレイス７階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

of an intermediate phase and the content proportion of the amorphous phase in the polishing layer measured via a pulse NMR method in a wet state at 40°C is 0.4-0.9.

(57) 要約：段差解消性能及び平坦化性能に優れた研磨パッドを提供することを目的とする。イソシアネート末端プレポリマー及び硬化剤を原料とするポリウレタン樹脂発泡体からなる研磨層を有する研磨パッドであって、湿潤状態におけるパルスＮＭＲ法により４０℃で測定される研磨層における結晶相の含有割合と非晶相の含有割合の比が０．５以上、１．０以下であり、湿潤状態におけるパルスＮＭＲ法により４０℃で測定される研磨層における中間相の含有割合と非晶相の含有割合の比が０．４以上、０．９以下である、ことを特徴とする研磨パッド。